

第十八改正日本薬局方第二追補 改正

一般試験法 2.03 薄層クロマトグラフィー 塗布装置

CAMAG 薄層クロマトグラフィー


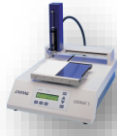

既に第十七改正日本薬局方（平成 28 年 3 月 7 日厚生労働省告示第 64 号）の参考情報に”生薬及び生薬製剤の薄層クロマトグラフィー〈G5-3-170〉”の規定があり、器具及び装置、検出及び可視化、操作方法等記載されていますが、第十八改正日本薬局方第二追補（令和 6 年 6 月 28 日厚生労働省告示第 238 号）より一般試験法 2.03 薄層クロマトグラフィーの項目が改正されました。

変更のポイント(塗布)

- ・ 医薬品各条に規定する試料溶液及び標準溶液を調整し、規定する容量を薄層板の原線上にスポットする
- ・ 定容量の毛細管、マイクロシリンジ、マイクロピペットなどを用いて、約 10 mm 以上の適切な間隔で直径 2~6 mm の円形状または幅 4~10 mm の帯状にスポットし、風乾する

CAMAG サンプル塗布装置

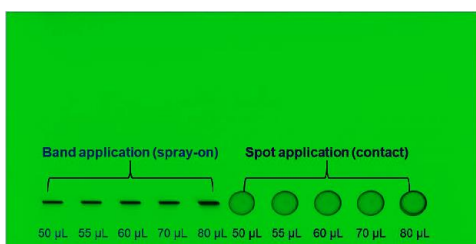
日本薬局方に基づく分析のできる装置

	ATS4	リノマート 5	ナノマート 4
			
サンプル吐出	シリンジ 10, 25, 100 μL	シリンジ 100, 500 μL	キャピラリー 0.5, 1, 2, 5 μL
サンプル吐出量	100 nL ~ 1 mL	100 nL ~ 5 mL	0.5 μL ~
スポット形状	スポット、帯状、長方形	スポット、帯状	スポット
自動化	任意の位置、量の塗布、洗浄、サンプル 66 本セット可能	任意の位置、量の塗布、シリンジはマニュアルで変更	マニュアルでの塗布

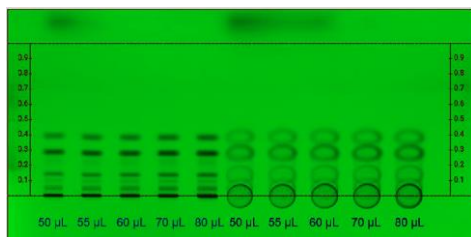
※ソフトウェアを使用した場合、21 CFR Part11 に準拠、IQOQ に対応可能

塗布例

展開前 帯状、スポットでの塗布後 254 nm で撮影



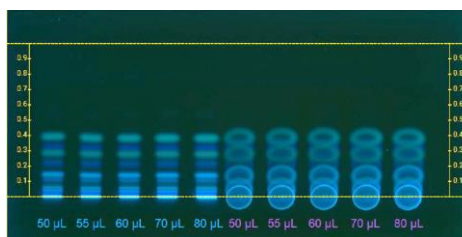
展開後 254 nm で撮影



帯状(バンド)での塗布

大量の塗布量でも展開後に重ならず、広がりを抑えることができます。

展開後 366 nm で撮影



サンプル : Angelica

装置 : ATS4

シリンジ : 100 μL

バンド幅 : 8 mm



英弘精機株式会社

<http://www.eko.co.jp>

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8
TEL: 03-3469-6711 FAX: 03-3469-6719
info@eko.co.jp

仕様は予告なく変更することがあります。